

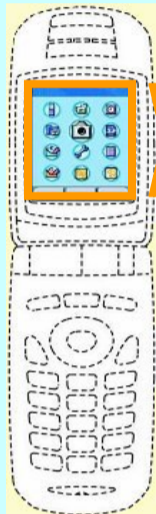
「意匠法等の一部を改正する法律」検討と対応

2006年6月7日法律第55号として公布

- 【主な改正点】** ①画面デザイン保護拡大 ②関連・部分・部品意匠出願時期緩和
 ③権利期間延長 ④実施行為へ輸出追加 ⑤間接侵害に所持行為追加 ⑥刑事罰強化 等

攻めと守いのバランス よい良い制度とは？

画面デザイン保護の検討



- * GUIを部分意匠で保護
- * 階層画面も保護対象
- * 物品自体も差止め？
- * 権利範囲どこまで？

特許庁と協議を図り
あるべき制度運用追求

新制度を如何に 活用すべきか！！

実務戦略の検討

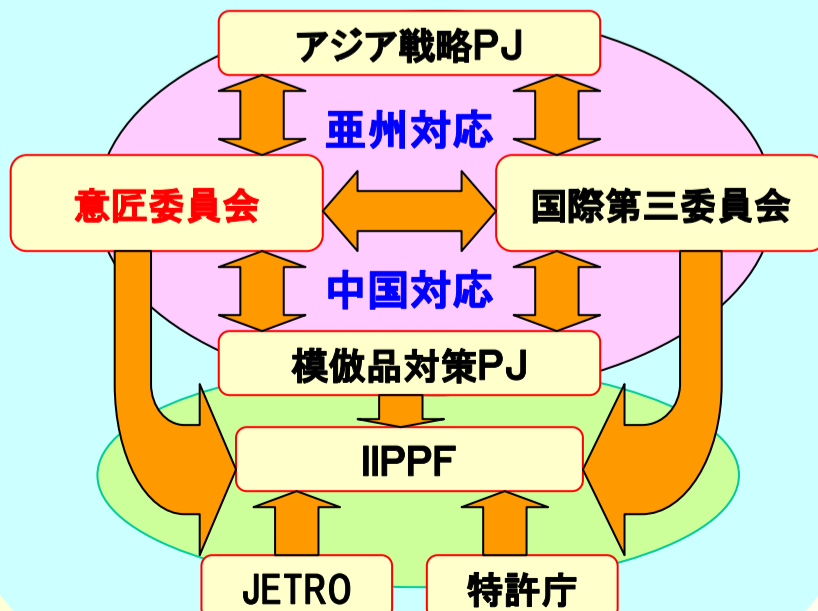
- * 実施製品をどう守る？
- * 新規保護対象への対応は？
- * 社内運用をどう変える？
- * 侵害回避の対応は？

臨時研修会で解説
改正法Q&Aで周知

アジア法改正等対応／実務運用研究

- 【本年改正対応】** 中国専利法改正案（その他台湾・韓国）
【本年制度意見】 中国・韓国・台湾・インド等へ意見発信
【実務運用研究】 国内・海外IPDLの意匠権利調査ツールの比較研究

対外施策には一致団結 連携・協力で対応！！



オリジナリティ追求 権利活用の活性化へ

権利調査活動を重要視



日本・中国・韓国・米国・欧州・台湾
IPDL研究

2月度部会報告予定

中国専利法(意匠部分)の改正案について

- 【動向】** 2006年 国家知識産権局から改正条文案の公表
2007年 全国人民代表大会での法案検討
2008年 改正法施行（見込み）

- 【改正が見送られる項目】** ① 審査主義の導入と部分意匠制度の導入
② 実施行為の拡大（「販売の申出」の追加）

【主な改正点】

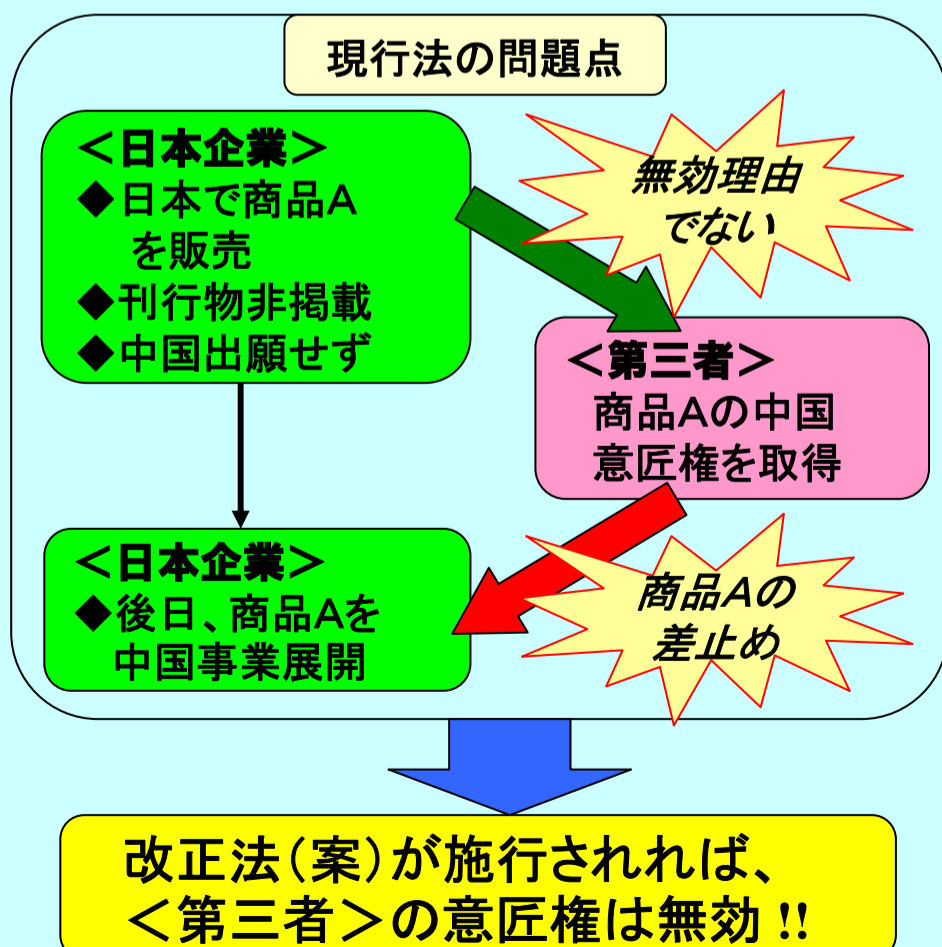
- ① 世界公知公用の導入
- ② 創作非容易性の登録要件への追加

【手続き面の改正点】

- ① 「検索報告書」の提出義務化（権利行使時）
- ② 「意匠の簡単な説明」等の文書提出義務化（出願時）
- ③ 関連意匠制度の導入（多意匠一出願）
- ④ 平面印刷物の意匠の登録除外

安定した中国事業が可能に…

① 世界公知公用の導入



② 創作非容易性の追加

